# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- CÓLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### Abstract for JP 06-214244

A substrate includes pixels in mxn matrix, an active element in pixels, driving means applying predetermined voltage waveform, an electric field parallel to a substrate in pixels, and controlling orientation of liquid crystal molecules by potential difference between a signal line during scanning and an adjacent scanning line in order to control light.

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号

## 特開平6-214244

(43)公開日 平成6年(1994)8月5日

(51)IntCL <sup>5</sup> G 0 2 F G 0 9 G	1/1343 1/137 3/36	識別記号	庁内整理番号 8707-2K 9315-2K 7319-5G	ΓI	技術表示箇所
				審査請求	未請求 請求項の数15 OL (全 9 頁)
(21)出顯番号	<del></del>	特頭平5-4664		(71)出願人	000005108 株式会社日立製作所
(22)出顧日		平成5年(1993)1	月14日	(72)発明者	東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地 三島 康之 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内
				(72)発明者	津村 誠 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内
		·		(72)発明者	近藤 克己 茨城県日立市大みか町七丁目1番1号 株 式会社日立製作所日立研究所内
				(74)代理人	弁理士 小川 勝男

### (54)【発明の名称】 アクティブマトリクス型液晶表示装置

#### (57) 【要約】

【目的】低コスト, 視角特性が良好で、表示特性が良く 多階調表示が容易といった特徴を有するアクティブマト リクス型液晶表示装置を得る。

【構成】m×n個のマトリクス状の画素と、画素内のアクティブ案子と、所定電圧波形を印加する駆動手段と、画素内に上下基板間のギャップを一定に保つ電極対を有し、かつ前記電極対間に基板面に平行な電界を印加することにより液晶分子の配向状態を制御し光を変調し得る所定構造を有する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】絶縁基板上に配置された電極対間に電位差を設け、その電位差で発生した前記基板面に平行な電界によって液晶を駆動させる構造を持ち、かつ電極対間で電極近傍にある液晶を前記電極対を構成する電極の側壁面の形状により制御を行うことを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】絶縁基板上に配置された2つの電極対間に 電位差を設け、その電位差で発生した前記基板面に平行 な電界によって液晶を駆動させる構造を持つ液晶表示装 10 置において少なくとも前記電極対を構成する一つの電極 の基板面に対しての垂直方向の膜厚と、前記電極対に電 圧を供給する電圧供給線の基板面に対しての垂直方向の 膜厚とが異なることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項3】前記電極対の少なくとも1つの電極の基板面に対して垂直方向への膜厚により前記基板ともう一枚の基板とを前記電極の膜厚と同じ一定のギャップを与えて張り合わせることを特徴とする請求項2項記載の液晶表示装置。

【請求項4】少なくとも1組以上の前記電極対で構成さ 20 れる電極群で構成されており、それぞれの電極対の片方の電極は同一の電圧信号線に接続され、残りの電極ももう一本の電圧信号線に共通に接続されていることを特徴とする請求項1項及び2項記載の液晶表示装置。

【請求項5】前記電極対の少なくとも1つの電極がアクティブ素子と接続されていることを特徴とする請求項4項記載の液晶表示装置。

【請求項6】前記電極対を構成するそれぞれの電極において、その形状は棒状で、かつその電極の長手方向は、もう一方の電極の長手方向と互いに平行であるように配 30 置されたことを特徴とする請求項5項記載の液晶表示装置。

【請求項7】前記液晶表示装置において装置内の全て電極対において長手方向が互いに平行であること特徴とする請求項6項記載の液晶表示装置。

【請求項8】前記電極対の表面に前記液晶の配向を制御する配向制御膜が塗布されてないことを特徴とする請求項7項記載の液晶表示装置。

【請求項9】前記液晶表示装置において各電極対に挟まれた液晶が電極対の長手方向とほぼ平行になるよう配向 40 されていることを特徴とする請求項8項記載の液晶表示装置。

【請求項10】前記液晶表示装置において、少なくとも一方が透明な一対の基板と前記基板対間に封入された液晶、前記基板の一方の上にm本の走査線, n本の信号線とコモン線, m×n個のマトリクス状の画素、及び前記各画素内に設けられたアクティブ素子,容量素子,前記電極対からなる液晶パネル、及び前記信号線と走査線とコモン線に電圧を印加する手段とを備えたことを特徴とする請求項7項及び請求項9項記載の液晶表示装置。

2

【請求項11】前記画素内においてアクティブ素子が薄膜トランジスタであり、前記薄膜トランジスタのゲート電極が前記走査線に、ドレイン電極が前記信号線に、ソース電極が前記電極対の一方の電極(画素電極と称す)に接続され、さらにもう一つの電極(コモン電極と称す)がコモン線に、容量素子がソース電極と接続されており、各行毎の全ての画素が共通の走査線に接続され、各列毎の全ての画素が共通のコモン線に接続され、各列毎の全てのコモン電極が共通のコモン線に接続され、ソース電極と前段の走査線との間に容量素子を設けていることを特徴とする請求項10項記載の液晶表示装置。

【請求項12】前記液晶表示装置において隣接する奇数 列画素と偶数列画素の全てのコモン電極を1本のコモン 線に接続を行うことを特徴とする請求項11項記載の液 晶表示装置。

【請求項13】前記液晶表示装置において前記信号線を 覆うようにコモン線を絶縁体を介して信号線配設位置に 形成することを特徴とする請求項11項記載の液晶表示 装置。

【請求項14】前記液晶表示装置においてコモン線の線幅が、信号線の線幅よりも広いことを特徴とする請求項13項記載の液晶表示装置。

【請求項15】前記液晶表示装置において少なくと各コモン線の少なくとも一方の先端と前記基板対を張り合わせるシール材との間に開口部を設けたことを特徴とする請求項14項記載の液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、表示品質に優れアクティブマトリクス型液晶表示装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来のアクティブマトリクス型液晶表示 装置では、液晶層を駆動する電極としては2枚の基板界 面上に形成し相対向させた透明電極を用いていた。これ は、液晶に印加する電界の方向を基板界面にほぼ垂直な 方向とすることで動作する、ツイストッドネマティック 表示方式を採用していることによる。一方液晶に印加する電界の方向を基板界面にほぼ平行な方向とする方式 は、海型電極対を用いた方式が、例えば特開平1-12052 8 号により提案されている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、前記の従来ツイステッドネマティック表示方式を用いた技術においては、液晶に電圧を印加し、かつ、光を透過させる必要があるので、ITOに代表される透明電極を形成する必要が有った。その為に、透明電極を形成するためのスパッタリング装置等の真空系製造設備が必要で、設備コストが巨額になっていた。また、真空系製造設備の使用は、スループットの低下を引き起こし、このことがアクティブマトリクス型液晶表示装置の製造コストを著しく引き

3

上げている。また、一般に透明電極はその表面に数10 nm程度の凹凸があり、薄膜トランジスタのような微細なアクティブ素子の加工を困難にしている。さらに、透明電極の凸部はしばしば離脱し電極等の他の部分に混入し、点状或いは線状の表示欠陥を引き起こし、歩留よりを著しく低下させていた。これらの為に、マーケットニーズに対応した低価格の液晶表示装置を安定的に提供いることが出来ずにいた。また、前記の従来技術におよっては、画質面でも多くの課題を有していた。特に、視角を変化させた際の輝度変化が著しく、中間調表示を困難にしていた。それに対して、基板面にほぼ平行な方の電界を液晶に印加する方法は、マトリクス型表示装面に用いた場合、不要な電界の影響を受けやすく、クロストークが発生しやすいことから、従来の公知例においては、アクティブマトリクス型表示装置に用いた例はない

【0004】本発明はこれらの課題を同時にので、その目的とするところは、第一に、透くとも高コントラストで、低価格の設備で高で量産可能な低コストのアクティブマトリクス型液晶表 20 示装置を提供することにある 第二に 視角特性が良好

示装置を提供することにある。第二に、視角特性が良好で多階調表示が容易であるアクティブマトリクス型液晶表示装置を提供することにある。第三に不要な電界の影響を受けにくく、クロストークが発生しないアクティブマトリクス型表示装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、本発明は、第1の装置として、絶縁基板上に配置された電極対間に電位差を設け、その電位差で発生した前記基板面に平行な電界によって液晶を駆動させる構造を 30 持ち、かつ電極対間で電極近傍にある液晶を前記電極対を構成する電極の側壁面の形状により制御を行うことを特徴とする液晶表示装置を構成した物である。

【0006】第2の装置として、絶縁基板上に配置された2つの電極対間に電位差を設け、その電位差で発生した前記基板面に平行な電界によって液晶を駆動させる構造を持つ液晶表示装置において少なくとも前記電極対を構成する一つの電極の基板面に対しての垂直方向の膜厚と、前記電極対に電圧を供給する電圧供給線の基板面に対しての垂直方向の膜厚とが異なることを特徴とする液 40 晶表示装置を構成したものである。

【0007】第2の装置を含む第3の装置として前記電極対の少なくとも1つの電極の基板面に対して垂直方向への膜厚により前記基板ともう一枚の基板とを前記電極の膜厚と同じ一定のギャップを与えて張り合わせることを特徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0008】第1の装置、および第2の装置を含む第4の装置として、少なくとも1組以上の前記電極対で構成される電極群で構成されており、それぞれの電極対の片方の電極は同一の禁圧信息線に接続され、離りの電極も

もう一本の電圧信号線に共通に接続されていることを特 徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0009】第4の装置を含む第5の装置として前記電極対の少なくとも1つの電極がアクティブ素子と接続されていることを特徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0010】第5の装置を含む第6の装置として前記電極対を構成するそれぞれの電極において、その形状は棒状で、かつその電極の長手方向は、もう一方の電極の長手方向と互いに平行であるように配置されたことを特徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0011】第6の装置を含む第7の装置として前記液 晶表示装置において装置内の全て電極対において長手方 向が互いに平行であること特徴とする液晶表示装置を構 成したものである。

【0012】第7の装置を含む第8の装置として前記電 己液晶の配向を制御する配向制御膜が塗 こを特徴とする液晶表示装置を構成した

【0013】第8の装置を含む第9の装置として前記液 晶表示装置において各電極対に挟まれた液晶が電極対の 長手方向とほぼ平行になるよう配向されていることを特 徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0014】第7の装置及び第9の装置を含む第10の装置として、少なくとも一方が透明な一対の基板と前記基板対間に封入された液晶、前記基板の一方の上にm本の走査線、n本の信号線とコモン線、m×n個のマトリクス状の画素、及び前記各画素内に設けられたアクティブ素子,容量素子、前記電極対からなる液晶パネル、及び前記信号線と走査線とコモン線に電圧を印加する手段とを備えたことを特徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0015】第10の装置を含む第11の装置として前記画素内においてアクティブ素子が薄膜トランジスタであり、前記薄膜トランジスタのゲート電極が前記走査線に、ドレイン電極が前記信号線に、ソース電極が前記電極対の一方の電極(画素電極と称す)に接続され、さらにもう一つの電極(コモン電極と称す)がコモン線に、容量素子がソース電極と接続されており、各行毎の全ての画素が共通の信号線に接続され、各列毎の全ての画案が共通の信号線に接続され、各列毎の全ての画案が共通のコモン線に接続され、ソース電極と前段の走査線との間に容量素子を設けていることを特徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0016】第11の装置を含む第12の装置として前記液晶表示装置において隣接する奇数列画素と偶数列画素の全てのコモン電極を1本のコモン線に接続を行うことを特徴とする液晶表示装置を構成したものである。

される電極群で構成されており、それぞれの電極対の片 【0017】第11の装置を含む第13の装置として前方の電極は同一の電圧信号線に接続され、残りの電極も 50 記液晶表示装置において前記信号線を覆うようにコモン

線を絶縁体を介して信号線配設位置に形成することを特 徴とする液晶表示装置を構成したものである。

【0018】第13の装置を含む第14の装置として前 記液晶表示装置においてコモン線の線幅が、信号線の線 幅よりも広いことを特徴とする液晶表示装置を構成した

【0019】第14の装置を含む第15の装置として前 記液晶表示装置において少なくと各コモン線の少なくと も一方の先端と前記基板対を張り合わせるシール材と間 に開口部を設けたことを特徴とする液晶表示装置を構成 10 したものである。

#### [0020]

【作用】次に本発明の作用を図1を用いて説明する。

【0021】図1 (a), (b) は本発明の液晶パネル内 での液晶の動作を示す側断面を、図1 (c), (d) はそ の平面図を表す。図1ではアクティブ素子を省略してあ る。また、電圧無印加時のセル側断面を図1(a)に、 その時の平面図を図1 (c) に示す。透明な一対の基板 101,102の内側は配向制御膜401A,402Bが 塗布及び配向処理されている。その上に線状の電極20 8,209が形成されている。さらに前記基板間には液 晶層210が挟持されている。ここで電極208, 209 は主として各電極の長手方向の側壁面503,504に より、電極間の液晶に印加する電界を制御する構造をし ている。例えば図5に示すように電極208,209の 基板面に対し垂直方向の膜厚を厚くし、側壁面503, / 504が液晶層をはさみ込み、かつ側壁面503,50 4とがほぼ平行になるような構造を図1の電極として使 用する。これにより電極の上面部506、505でなく 側壁面503,504によって両電極に挟まれた液晶層 30 全域にほぼ基板面に平行な電界を印加することができ る。また、図1には電極が2本しか示してないが、図2 に示すように配線120に電極121を複数接続し配線 122に電極123を複数接続したものを櫛型に配置し た電極群を構成し各電極間に電界を印加するものでも良

【0022】電界液晶層中の棒状の液晶分子501は、 電界無印加時にはストライプ状の電極の長手方向に対し て若干の角度、即ち45度≤│電界方向に対する界面近 傍での液晶分子長軸(光学軸)方向のなす角 | <90 度、をもつように配向されている。上下界面上での液晶 分子配向方向はここでは平行を例に説明する。

【0023】電界502を印加すると図1(b),(d) に示したように電界方向に液晶分子がその向きを変え る。偏光板404A, 404Bの偏光透過軸を所定角度/ に配置することで電界印加によって光透過率を変えるこ とが可能となる。したがって、光を電極の間を透過し変 調されるので、電極は透明でなくとも良い。このよう に、本発明によれば透明電極がなくともコントラストを 与える表示が可能となる。コントラストを付与する具体 50

的構成としては、上下基板上の液晶分子配向がほぼ平行 な状態を利用したモード(複屈折位相差による干渉色を 利用するので、ここでは複屈折モードと呼ぶ)と、上下 基板上の液晶分子配向方向が交差しセル内での分子配列 がねじれた状態を利用したモード(液晶組成物層内で偏 光面が回転する旋光性を利用するので、ここでは旋光性 モードと呼ぶ)とがある。複屈折モードでは、電圧印加 により分子長軸(光軸)方向が基板界面にほぼ平行なま まの面内でその方位を変え、所定角度に設定された偏光 板の軸とのなす角を変えて光透過率を変える。旋光性モ ードでも同様に電圧印加により分子長軸方向の方位のみ を変えるが、こちらの場合はら線がほどけることによる 旋光性の変化を利用する。従来のTN型のように液晶分 子長軸を基板界面に垂直に立ち上がらせる場合だと、複 屈折位相差が0となる視角方向は正面即ち基板界面に垂 直な方向のみであり、僅かでも傾斜すると複屈折位相差 が現れる。ノーマリオープン型では光が漏れ、コントラ ストの低下や階調レベルの反転を引き起こす。

【0024】しかし、本発明の表示モードは従来のよう に電圧印加で複屈折位相差をほぼりにすることで暗状態 を得るものではなく、液晶分子長軸と偏光板の軸(吸収 あるいは透過軸)とのなす角を変えるもので、根本的に 異なる。

【0025】また、図3に示すように電極521,52 2の基板面の上面523,524によって電界を制御 し、液晶を駆動する場合、液晶層には例えばE1,E 2, E3に示すような電極近傍では基板面に対し垂直な 方向を向く電界512が発生する。この電界512によ り電極近傍の液晶分子長軸は基板面に垂直な方向に立ち 上がるため、その部分では、光漏れが発生しコントラス トの低下が発生する。

【0026】本発明の表示モードでは電極間に挟まれた 液晶分子の長軸は基板と常にほぼ平行であり、立ち上が ることがなく、従って視角方向を変えた時の明るさの変 化が小さいので、視角依存性がなく、視角特性が大幅に 向上する。

【0027】この効果は図4に示すように電極514の 側壁面525と電極520の上面部526とで両電極間 の電界を制御する場合においても、本発明の効果が得ら 40 れる。

【0028】さらに、側壁面により電界を制御する電極 において、その電極の基板面に垂直方向の膜厚により基 板101、102のギャップを保持する構造にする。こ れにより、従来は上下基板のギャップを得るのにスペー サとして球形のポリマービーズを基板間に分散させるこ とを行っていたが、基板内に均等に分散せず、基板内に ギャップむらが発生することによって、表示時に輝度む らが発生していた。しかし、本発明によれば電極対をス ペーサとして用いているため、基板内のギャップむらは 発生せず、輝度むら等の不良表示を解消することができ

る。

[0029]

【実施例】本発明を実施例により具体的に説明する。

【0030】 (実施例1) 図6に本発明による液晶アク ティブマトリクス表示装置の一実施例を示す等価回路を 示している。基板102上に走査線104と信号線10 3がマトリクス状に配線され、走査線104と信号線1 03の各交点にはアクティブ素子を介して画素106が 接続されている。走査線104と信号線103にはそれ ぞれ走査駆動回路108,信号駆動回路107に接続さ れ各走査線または信号線に任意の電圧を印加できる。さ らに、基板102信号線に平行にコモン線105を配設 され全ての画素に接続されており、全画素にコモン電圧 発生回路109からコモン電圧を印加できるようになっ ている。基板102と基板101間には液晶組成物が封 入されており、全体として液晶アクティブマトリクス表 示装置となっている。次に画素106の実施例を図7の 平面図を用いて示す。走査線104A, 104Bを水平方向に形 成し、走査線と直交させ信号線103A、103Bを垂 直方向に形成する。さらに信号線103A、103Bと に挟まれ、かつ平行にコモン線105を103Bに隣接 させて形成する。またアクティブ素子用として設けられ たアモルファスシリコン301を用いた薄膜トランジス タ素子211を形成し、そのゲート電極212を走査線 104Aに接続し、ドレイン電極213を信号線103Aに 接続し、ソース電極214を画素電極208に接続した (実際の駆動状態では、ドレインとして働くこともある が、本実施例では、信号線に接続している電極をドレイ ン電極と定義し、画素電極に接続しているまたは画素電 極になっている電極をソース電極と定義する)。

【0031】本実施例では、アクティブ案子としてアモルファスシリコン薄膜トランジスタ素子を形成して用いるが、他にポリシリコン薄膜トランジスタ素子、シリコンウエハ上のMOS型トランジスタ、またはMIM(Metal-Intrinsic-Metal)ダイオード等の2端子素子(厳密にはアクティブ素子ではないが、本発明ではアクティブ素子とする)を用いてもよい。

【0032】またソース電極214と走査線104Bの間に容量素子203を形成する。ここで、容量素子203は、ソース電極の信号によるノイズを吸収し、電位を定電位に保持するために設けている。さらにコモン電極209は画素電極208間には液晶層が狭持され全体として画素表示部202を形成し、コモン電極209はコモン線105と接続されている。

【0033】図8に図7中のA-A'の断面図を示す。 基板102にゲート電極301を形成する。また走査線 104A, 104Bも同時に形成され走査線104Aは ゲート電極301に接続されている。次にゲート絶縁膜 402を例えば窒化シリコン等で形成する。そしてゲー ト絶縁膜402のゲート電極212に対向する部分には 50

例えば水素化アモルファスシリコンからなる半導体層3 01を形成しさらに半導体層301上には互いに電気的 に分離されたN型水素化アモルファスシリコンからなる オーミック層405A,405Bを設ける。次にソース 電極214,ドレイン電極213及び信号線103A, 103B,コモン線105を同時に形成した後、画素電 極208及びコモン電極209を形成する。さらに窒化 シリコン等の保護膜403,ポリイミド系の配向制御膜 401Aを形成する。

【0034】ここで画素電極208及びコモン電極20 9の基板面に対して垂直方向の膜厚は少なくともどちらか一方がソース電極214,ドレイン電極213及び信号線103A,103B,コモン線105の基板面に対して垂直方向の膜厚よりも厚く形成し、どちらか一方の電極の側壁面が画素電極とコモン電極の間に発生させる電界の制御に用いるようにする。ここでは両方の電極の側壁面で電界を制御する構成を取っている。

【0035】ここで図7においては画素電極208及び コモン電極209の長手方向が信号線に対して平行に形 成するように図示しているが、ゲート線に対して平行に 形成しても良い。

【0036】また、各電極、各配線には特に材料の制約はなく、タンタル、クロム、アルミニウム等でもよいが、駆動回路との接続端子部での腐食を考慮すると、対腐食性の強い金属が望ましい。また走査線104は、電気抵抗の低い金属が望ましいので、走査線は2層以上の金属層で構成してもよい。本実施例においては1つの薄膜トランジスタ素子を用いたが、2つ以上の薄膜トランジスタ素子を用いて冗長構成をとってもよい。同様に容量素子も2つ以上用いても構わない。

【0037】基板101にはストライプ状のR, G, B 3色のカラーフィルタ406を備えた。カラーフィルタ406の上には表面を平坦化する透明樹脂407を積層する。透明樹脂407の材料としてはエポキシ樹脂を用いる。更に、この透明樹脂407上にポリイミド系の配向制御膜407Bを塗布している。

【0038】基板102と基板101との間には液晶層210が封入され基板101は基板102に接合を行い液晶層210の厚さ(基板間のギャップ)は画素電極とコモン電極の基板面に対して垂直方向の膜厚dによって決定される。

【0039】図9に図7中のB-B'の断面図を示す。 容量素子203は走査線104Bとソース電極214の 一部を用いてゲート絶縁膜402を介して形成されてい る。これらの基板間に誘電率異方性Δεが正でその値が 4.5 であり、複屈折Δnが0.072(589nm, 2 0℃)のネマチック液晶組成物210を挟む。基板10 2の表面に塗布したポリイミド系配向制御膜401Aを ラビング処理して、3.5 度のプレチルト角とする。上 下界面上のラビング方向は互いにほぼ平行で、かつ印加

電界方向とのなす角度を85度とする。上下基板のギャ ップは液晶組成物封入状態で $4.5 \mu$ mとすると、 $\Delta n$ ・dは0.324µmとなる。2枚の偏光板404A, 404Bでパネルを挾み、一方の偏光板の偏光透過軸を ラピング方向にほぼ平行(85°)とし、他方をそれに 直交(-5°)とする。これにより、ノーマリクローズ特 性を得る。このときネマチック液晶組成物210として 負の誘電率異方性 Δεをもつものに対しては初期配向状 態を画素電極の長手方向にほぼ垂直な方向に配向させる ことにより使用可能となるが、配向制御膜401Aを画 10 素電極208の長手方向にほぼ垂直な方向にラビングを 行うため画素電極及びコモン電極の近傍にラビングむら

【0040】図10に画素106の等価回路を示す。IF T211は所定の走査線104Aにゲートパルスが印加され ている期間導通状態になりその時所定の信号線103に 出力されている映像信号に応じて容量素子203に電荷 が蓄積され画素電極とコモン電極間に電界が生じ電界方 20 向に液晶層中の液晶分子がその向きを変える。これによ り偏光板を所定の角度に配置することで電界印加によっ て光透過率を変化させることが可能となる。

が生じ、配向不良を起こしやすいために正の誘電率異方

性Δεをもつものを使用し、ラビングは画素電極の長手

方向にほぼ平行な方向に行うほうが望ましい。

【0041】さらにゲートパルスが次の走査線に移ると TFI211は非導通状態になり、つぎに走査を受けるまで容 **量素子203の蓄積された電荷によって画素電極とコモ** ン電極の電位差が保持され液晶の駆動状態が保たれる。 【0042】 [実施例2] 本実施例の構成は下記の要件

を除けば、実施例1と同一である。

【0043】図11に本実施例の画素の断面図を示す。 ソース電極214, ドレイン電極213及び信号線10 3A, 103B, コモン線105を同時に形成した後に 窒化シリコン等の保護膜403,ポリイミド系の配向制 御膜401Aを形成し、ラピング等の配向処理を行う。 配向処理後、ドライエッチング等によりソース電極30 3及びコモン線105と基板上部と間にコンタクトホー ルを形成する。その後画素電極208及びコモン電極2 09を形成する。これにより実施例1のように画素電極 及びコモン電極の近傍にラビングむらが生じ、配向不良 を起こすことがなくなるため、ラビング方向を自由に設 40 得られる。更に、低電圧かつ低消費電力のアクティブマ 定できる。よって、誘電率異方性 Δε が負の液晶も正の ものと同等に使用できる。

【0044】 [実施例3]]本実施例の構成は下記の要件 を除けば実施例2と同一である。

【0045】図12に本実施例の画素の断面図を示す。 ソース電極214、ドレイン電極213及び信号線10 3A、103Bを同時に形成するさいにコモン線105 は形成せず、画素電極208及びコモン電極とコモン線 を同時に兼ねたコモン電極兼用線220を信号線103 Bが配線されている位置に保護膜403,配向制御膜4

10

01Aを介して信号線103Bを覆うように形成する。 さらにコモン電極兼用線220の線幅は信号線103B の線幅よりも厚く信号線103Bが完全にコモン電極兼 用線220の下に隠れるように形成する。これにより信 号線から液晶層に発生する電界を防ぎ、かつ信号線とコ モン線を配設させる面積が小さくなり画素表示部の領域 が広くなることにより光を透過する有効部分(開口部)の 面積を増やすことができ、透過率をアップすることがで きる。また、図13にコモン電極兼用線をパネルに配線 したときのパネル端部の一部分の平面図を示す。図に示 すように各列毎のコモン電極兼用線220の少なくとも 一方の先端は基板101と102を張り合わせるシール 材701との間にはコモン電極兼用線を配設しない開口 部702を形成する。この開口部702を設けること で、液晶を封入するさいに封入口は一箇所でよく、液晶 パネルの製造を安易に行うことができる。

【0046】 [実施例4] 本実施例の構成は下記の要件 を除けば実施例1及び実施例2と同一である。

【0047】図8に本実施例の等価回路を示す。奇数列 画素509とそれに隣接する偶数列画素600におい て、画案509内のコモン電極612と画案600内の コモン電極613を同一のコモン線611に接続し、コ モン線611をはさんで奇数列画素509に相対するよ うに偶数列画素600を構成する。これにより実施例1 よりもコモン線本数が半分となり、その結果、コモン線 を配設させる面積が小さくなり画素表示部の領域が広く なることにより光を透過する有効部分(開口部)の面積 を増やすことができ、透過率をアップすることができ、 歩留まりが向上する。

#### 30 [0048]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 表示に使用する画素電極とコモン電極間の全ての液晶分 子に対し、選択した同一の電界を印加することができ、 低電圧で高コントラストを得ることができる。

【0049】また、液晶を封入している2枚の基板間の ギャップを得るのに外部からスペーサを入れる必要がな くなり、スペーサのかたよりによる基板内のギャップム ラが解消されることにより、輝度傾斜等の画質不良がな くなり高画質のアクティブマトリクス型液晶表示装置が トリクス型液晶表示装置も同時に得られる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の液晶表示装置における液晶の動作を示

【図2】本発明の画素電極の応用例の平面図を示す図。

【図3】 従来の液晶表示装置における液晶の動作を示す

【図4】本発明の応用例の液晶の動作を示す図。

【図5】本発明に用いた電極対の斜視図を示す図。

【図6】実施例1の液晶表示装置の概略図。

【図7】実施例1の画素構成の平面図を示す図。

【図8】実施例1の画素構成のA-A'線における断面図を示す図。

【図9】実施例1の画素構成のB-B'線における断面図を示す図。

【図10】実施例1の画案構成の等価回路を示す図。

【図11】実施例2の画素構成のA-A'線における断面図を示す図。

【図12】実施例3の画案構成のA-A'線における断面図を示す図。

【図13】実施例3のパネル端部の平面の一部を示す図.

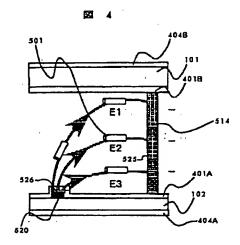
【図14】実施例4の画素構成の等価回路を示す図。 【符号の説明】

101, 102…基板、103, 103A, 103B, 609, 610…信号線、104, 104A, 104B, 607, 608…走査線、105, 611…コモン線、

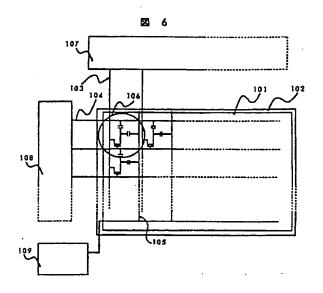
106…画素、107…信号駆動回路、108…走査駆 動回路、109…コモン電圧発生回路、120,122 …配線、202…画案表示部、203…容量素子、20 8…画素電極、209,612,613…コモン電極、2 10…液晶層、211…薄膜トランジスタ、212…ゲ ート電極、213…ドレイン電極、214…ソース電 極、220…コモン電極兼用線、301…半導体層、4 01A, 401B…配向制御膜、402…ゲート絶縁 層、403…保護膜、404A, 404B…偏光板、4 05A,405B…オーミック層、406…カラーフィ ルタ、407…透明樹脂、501…液晶分子、502, 512…電界、503, 504, 525…電極側壁面、 505, 506, 523, 524, 526…電極上面 部、509…奇数列画案、121,123,514,5 20,521,522…電極、600…偶数列画素、70 1 …シール材、702…開口部。

12

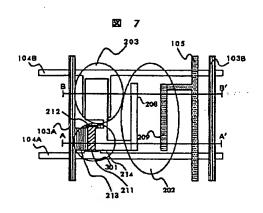
[図4]



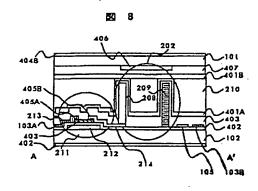
【図6】



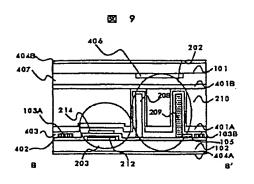
【図7】



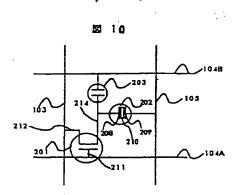
【図8】



【図9】

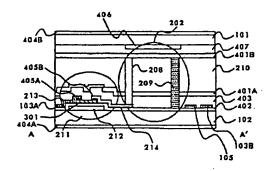


【図10】



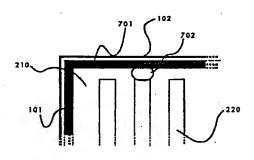
[図11]

**21** 11



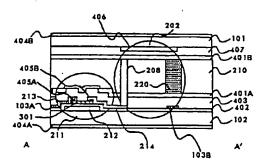
【図13】

图 13



【図12】

፟. 12



[図14]

፟ 14

